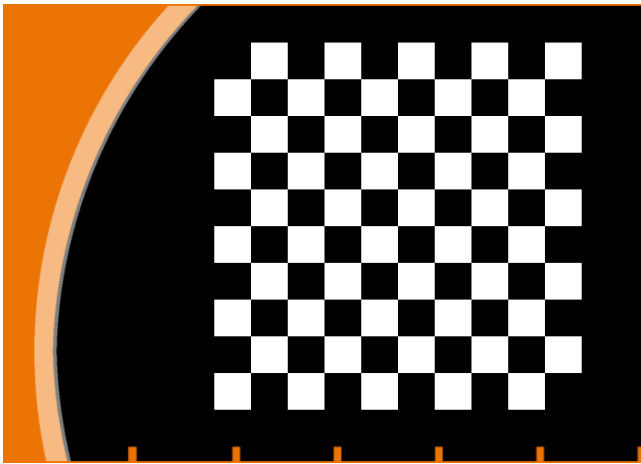


Schachbrettmuster TC-CB100

Schachbrett mit $100 \times 100 \mu\text{m}^2$ Quadraten



Dieses $9.0 \times 9.0 \text{ mm}^2$ große Schachbrettmuster aus quadratischen $100 \times 100 \mu\text{m}^2$ Feldern eignet sich insbesondere für die Prüfung von Verzeichnung und Bildfeldwölbung. Die sehr scharfen Kanten eignen sich aber auch zur Bestimmung der lokalen Abbildungsqualität.

(Abbildung schematisch)

Unsere hochauflösenden Testcharts sind mit hochpräziser E-Beam-Lithographie hergestellt. Als Träger dient ein Quarzsubstrat mit breiter spektraler Transmission (DUV-VIS-NIR), auf das eine Chromschicht hoher optischer Dichte aufgetragen ist. Die Teststrukturen werden durch die Abtragung der Chromschicht erzeugt, wobei Strukturgrößen bis zu 100 nm möglich sind und eine exzellente Maßhaltigkeit und Geradheit der Strukturkanten gewährleistet ist.

Wir bieten auch eine Version mit einem 0.17 mm Deckglas für die Verwendung mit Mikroskopobjektiven an.

Substrat	Quarzwafer (Fused Silica), 10mm x 10mm x 1 mm
Träger	Objekträger-Format 75mm x 25mm x 1.5mm, Edelstahl mit Lasergravur
Strukturierte Schicht	Chrom, optische Dichte OD > 8@400nm / 6@550nm / 4.5@750nm / 3.6@1 μm
Struktur	Schachbrettmuster $9.0 \times 9.0 \text{ mm}^2$ bestehend aus 90×90 Feldern der Größe $100 \times 100 \mu\text{m}^2$
Maßhaltigkeit (max. Absolutfehler)	100nm/cm = 10^{-5}
Spektraler Transmissionsbereich	200nm – 2000nm
Deckglas (optional)	0.17 mm optische Dicke